

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月6日(06.03.2025)



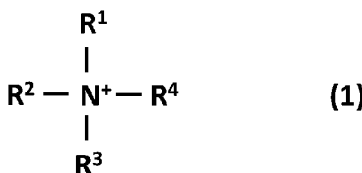
(10) 国際公開番号

WO 2025/047955 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/32 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01) H01L 21/306 (2006.01)
G03F 7/40 (2006.01) H01L 21/308 (2006.01)
H01L 21/027 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/031289
- (22) 国際出願日: 2024年8月30日(30.08.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-142385 2023年9月1日(01.09.2023) JP
特願 2024-017580 2024年2月8日(08.02.2024) JP
特願 2024-077294 2024年5月10日(10.05.2024) JP
特願 2024-096739 2024年6月14日(14.06.2024) JP
- (71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 井上 裕史 (INOUE, Hiroshi); 〒7458648 山口県周南市御影町1-1 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 川端 雄一郎 (KAWABATA, Yuichiro); 〒7458648 山口県周南市御影町1-1 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人秀和特許事務所 (IP FIRM SHUWA); 〒1050001 東京都港区虎ノ門五丁目1-1番2号 オランダヒルズ森タワー14階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: ALKALINE AQUEOUS SOLUTION FOR SEMICONDUCTOR, METHOD FOR USE AS LOW-TOXICITY ALKALINE AQUEOUS SOLUTION FOR SEMICONDUCTOR, AND METHOD FOR PRODUCING ALKALINE AQUEOUS SOLUTION FOR SEMICONDUCTOR

(54) 発明の名称: 半導体用アルカリ水溶液、低毒性半導体用アルカリ水溶液として用いる方法及び半導体用アルカリ水溶液の製造方法



(57) Abstract: An alkaline aqueous solution for a semiconductor, said solution comprising (A)-(D). (A) A quaternary ammonium ion represented by formula (1), (B) a halide ion, (C) a hydroxide ion, and (D) water (in the formula, R^1 , R^2 , R^3 , and R^4 are each independently an alkyl group having 1-16 carbon atoms. However, the number of carbon atoms of one or more alkyl groups among R^1 , R^2 , R^3 and R^4 is 2-16.)

(57) 要約: 下記 (A) ~ (D) を含む、半導体用アルカリ水溶液。(A) 下記式 (1) で表される第四級アンモニウムイオン、(B) ハロゲン化物イオン、(C) 水酸化物イオン、(D) 水 (式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 はそれぞれ独立して、炭素数 1 ~ 16 のアルキル基であり、ただし、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 のうち、1 以上のアルキル基の炭素数が 2 ~ 16 である。)

[続葉有]

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）